

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成20年12月18日 (2008.12.18)

【公開番号】特開2007-191765(P2007-191765A)

【公開日】平成19年8月2日 (2007.8.2)

【年通号数】公開・登録公報2007-029

【出願番号】特願2006-12092(P2006-12092)

【国際特許分類】

C 2 3 C 14/06 (2006.01)

B 2 3 B 27/14 (2006.01)

B 2 3 C 5/16 (2006.01)

B 2 3 B 51/00 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 14/06 P

B 2 3 B 27/14 A

B 2 3 C 5/16

B 2 3 B 51/00 J

【手続補正書】

【提出日】平成20年10月29日 (2008.10.29)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

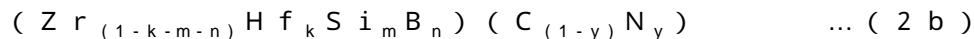
【補正対象項目名】0 0 2 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 9】

また前記第 2 の層も、少なくとも一部（特に全部）が、さらに S i 及び / 又は B を含有していてもよい。この S i 及び / 又は B を含有する第 2 の層は、下記式（2 b）で示される点を除き、前述の通常第 2 の層（2 a）と同じである〔なお下記式（2 b）は、B が炭窒化物を形成したもののみならず、B が、Z r、H f、S i などと硼化物を形成したものも含む〕。



〔式中の添字は、原子比を示す。m 及び n は、片方が 0 であってもよい。これら添字は、以下の関係を満足する。〕

$$\frac{0}{0} < (m+n) \leq 2$$

“m + n”の限定理由及び好ましい範囲は、前記“b + c”の場合と同様である。また m 及び n の片方が 0 になってよい理由等についても、前記 b、c の場合と同様である。k の好ましい範囲は、前記式 2 a の場合と同様である。